Country: JP Japan

Kind:

Inventor(s):MARUYAMA SATORU SAWADA HIRONOBU WATANABE HIROSHI

Applicant(s):TDK CORP

News, Profiles, Stocks and More about this company

Issued/Filed Dates: July 23, 1991 / Nov. 25, 1989

Application Number: JP1989000306126

IPC Class: C01G 31/00; C01G 37/00; H01B 1/08; H01C 7/02;

Abstract: Purpose: To prepare a conductive metal oxide exhibiting a metal semiconductor transition increasing resistance with the raising of temperature near the ordinary temperature by hydrolyzing a mixture of a V alkoxide and a specific element alcoholate, reducing the hydrolyzate and subsequently sintering the product. Constitution: A mixture of a V alkoxide (e.g. vanadyl ethoxide) and an alkoholate (e.g. chromium ethoxyethylate) of an element M (M is Cr, Ar or a rare earth element) is hydrolyzed with water to prepare (MxV1-x)2O5 ((x) is 0.001-0.5). The (MxV1-x) 2O5 is reduced in a H2 atmosphere, and the prepared (MxV1-x)2O3 is ground so as to give a diameter of the secondary particles of 0.5-1.0µm, molded and subsequently sintered in a H2 atmosphere at 1400-1450°C. COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

Other Abstract Info:DERABS C91-258083 DERC91-258083

Foreign References: (No patents reference this one)

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-170336

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)7月23日

C 01 G 31/00 37/00 7158-4G 7158-4G 7244-5G 6835-5E

H 01 B 1/08 H 01 C 7/02

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

49発明の名称

導電性金属酸化物の製造方法

②特 顧 平1-306126

②出 願 平1(1989)11月25日

@発明者 丸 山

哲 東京都中央区日本橋 1 丁目13番 1 号 ティーディーケイ株

式会社内

加発明者 澤田

博 信

讲

浩

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 テイーディーケイ株

式会社内

@発明者 渡辺

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株

式会社内

⑪出 顋 人 ティーディーケイ株式

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

会社

19代理 人 弁理士 若田 勝一

明 細

発明の名称

導電性金属機化物の製造方法

特許請求の範囲

 $(M_{x}V_{1-x})_{z}0_{z}$ (ただしM は Cr. A1、 希土類元素で、 X = 0 . 0 0 1 ~ 0 . 5)なる導電性金属酸化物を製造する方法であって、バナジウムのアルコキシドと前記元素M のアルコレートとの混合物を加水分解することにより $(M_{x}V_{1-x})_{z}0_{s}$ を得、酸 $(M_{x}V_{1-x})_{z}0_{s}$ を得、これを焼結することを特徴とする導電性金属酸化物の製造方法。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、3個のバナジウム酸化物のバナジウムの一部をクロム、アルミニウムあるいは希土類元素で置換した組成を有し、常型付近で温度上昇に件ない抵抗が増大する全属半導体転移を示す基準性金属酸化物を製造する方法に関する。

(従米の技術とその問題点)

酸化パナジウムには、V₂O₂、VO、V₂O₃等が存在するが、この中でV₂O₃は、160 K付近で絶縁体金属転移を、変型付近で金属半導体転移を示す。特にこの室型付近の金属半導体転移は、V₂O₃中に能加元素としてCr、Alあるいは希土類元素を用いることにより明瞭に現われる。この転移を利用してこの導電性金属酸化物を大電流用の風流素子として用いる試みが今までになされて来た。

前配の酸化物は(NaVira)203 (Mは前記Cr等の 抵加元素)で表現され、第1図に示すように、単 結晶を材料とすれば、常温付近における温度上昇 に件なう抵抗変化率が数百倍の材料が得られる一 方、従来の焼結法による焼結体の場合は百倍程度 が展度であり、単結晶を材料とした吸流素子を製 造することが望まれる。なお第1図の単結晶に関 するデータは、Kuwamotoらによる測定データであ る。(Physical Review 822 P2626(1980))。

しかし、前記クロム等で一部置換したバナジウム酸化物の単結晶としては、せいぜい直径4mm程度のサイズの小さいものしか得ることができない

ため、比較的大型の限流案子を得る場合は、やむをえず焼結体の形で限流案子材料を得ている。
が現状である。すなわち、従来は、まず V=0 = と Cr = 0 = を所定の比で型式組合し、乾燥した飲命を引きるという工程を引きるというなない。
を得て、成形して焼成するというなを得るため、焼結おおれて、このようなを得るため、結構ないるとのでは、がなるというでは、がなるというでは、焼結るというでは、焼結るので、、焼結をであるので、、焼結をであった。

上述のように、従来の焼薪体の場合には、単結 品に比較して、抵抗変化率が小さい理由は次のように考えられる。 室裏程度における金属半導体転 移は水における水と氷の転移と同様な一次 転移で あり、これは必ず体積変化を伴ない、ヒステリシ スを伴なうものである。従って、抵抗の変化も ルク全体が同時に起こるのではなく、部分的に起 これため、見かけ上抵抗変化も小さくなるので

3

(課題を解決するための手段)

上記の目的を達成するため、本発明による導電性金属酸化物の製造方法は、バナジウムのアルコキシドとクロム等の窓加元素のアルコレートとの混合物を加水分解して $(M_xV_{1-x})_{x0}$ 。を得、これを焼結することを特徴とする。

(作用)

本発明の方法において、(MaV1-a) *0。を得る工程はソルゲル法の一種であり、これにより添加元素をバナジウム酸化物中に均一に添加できる。より詳しくは、V*0。はゲル状をなすとき、層状構造をなすため、添加元素がその陰間に位置することが考えられる。その結果として、Cr等の証が反子オーダーで規則的に存在し、かつ記とV*0。が原子オーダーで規則的に存在し、かつ記合されていると推定される。さらに本発明によれば、加水分解後に従来法に比べて粒子の微細化ができる

従って、本発明により得られる導電性金属層化 物は、焼結体でありながら単結晶と同様の大きな る。従って、抵抗変化率を大きくするには、統結 体の各部がなるべく均一な特性すなわち均一な組 成であることが望ましいと考えられる。

焼結体等を作成する際に組成の均一性を得る手法として、例えばシュウ酸塩のPHを調節して沈 級を生じさせる共沈法や、金属イオンを含む溶液 を瞬時に蒸発させて金属粉末を得るスプレーバイ ロリシス法があるが、充分な結果が得られていない

(発明が解決すべき課題)

このように、従来技術によれば、単結基では大型の展流案子を得ることが困難であり、一方従来の焼結法によれば、大きな抵抗変化率が得られないのが現状であり、これらに代わる方法も見い出されていない。

本発明は、このような問題点を解決し、室温付近における抵抗変化率が大きく、かつ充分なサイズの(¾ V_{1-x}) ± 0。(M は前記添加元素)なる導電性金属酸化物が得られる製造方法を提供することを目的とする。

4

抵抗変化率を示し、統結温度も低くなる。 (字編得)

宝温で液体であるパナジルエトキシド(VO(OCaHaNa) z)とクロムエトキシエチレート(Gr(OCaHaOEt) z)をパナジウムとクロムが所定の比となるように含ませた適度 1 モル/kgのトルエン溶液を室温でエタノール溶液に観合し、その後ロータリーエパポレーターを用いてトルエンを蒸発させて溶媒はエタノールのみとした。この溶液を撹拌しながら純水を演下し、加水分解を行なった。この加水分解により Crを含む VaOa・ 3 HaOが 沈鬱として生成する。

なお、この化合物は、リバージュらの報告 (Material Reseach Bulltin Vol.16 p569 (1981))によると層状化合物をなしているが、このことは本発明者もX級回折により確認した。また、前記沈穀物において、抵加元業のクロムの正確な位置の判断はできないが、この種の化合物が $(M_{\pi}V_{1-\pi})_{2}O_{5}$ のプロンズ構造をとりやすいことから、バナジウムと食業が形成する層間にクロムが

局在した構造をとっていると考えられる。

次に前記沈麗のみを取り出すため、200℃で脱水後、 H_2 雰囲気でかつ600℃の温度で3時間避元し、 $(Cr_uV_{1-u})_2O_2$ を生成させ(この実施例の場合、X=0.005とした)、ボールミルで乾式粉砕し、2次粒子径として、0.5 μ m~1.0 μ mの粉体を得た。

この数体を原料とし、有機パインダーを混合 後、成形し、1400℃~1450℃で5時間、 計2 常囲気中で焼成し、直径20mmのディスクタイ プの焼結体を得た。焼成したサンブルについて は、直旋4端子法で抵抗を測定した。その結果を 第1図に示す。

第1図から分るように、本発明の方法による場合、抵抗変化率は単結晶の場合に比較しても遜色がなく、ほぼ同様の抵抗変化率が得られ、従来の焼結法による焼結体に比較し、抵抗変化率がはるかに大となった。また、焼結温度も従来の150 0℃以上に比較し、1400℃~1450℃程度と低くしてもよい。この理由は、2次粒子※はほ

7

表 1

-				
武料	製造	抵加	彩加量 x	抵抗変化
10	方法	元素	(M _X V _{1-X})₂0₃	(倍)
1 2	従来法	Al Al	0.003 0.008	80 80
3	木発明	Al	0.003	150
4		Al	0.008	300
5	従来法	La	0.004	80
6		La	. 0.009	90
7	本発明	La	0.004	200
8		La	0.009	300
9	從来法	Gd Gd	0.0035 0.005	50 70
1 1 1 2	木発明	Gd .	0.0035 0.005	200 300
13 14 15 16 17	本発明	666666	0.0005 0.001 0.003 0.1 0.5 0.8	- 200 500 400 10
19	単結晶	Gr	0.003	250
20		Cr	0.008	400

抵抗変化:R(最大值)/R(OC)

は従来と同じであるが、1次粒子径が小さくなっ たためである。

また、単結晶はせいぜい 直径が 4 mm程度のもの しか作成できないのが現状であるが、 本発明によ る場合には、 2 0 mm以上のものを容易に作成する ことができる。

以上本発明を実施例により説明したが、本発明は、バナジウムの原料として、前記以外に、バナジルブロポキシド、バナジルブロポキシド、バナジルメトキシド等の他のアルコキシドを用いることができ、また、クロムの原料として、クロムエトキシブロピレート、クロムエトキシブチレート、クロムエトキシメチレート等の他のアルキレートを用いることができる。

また、クロムの代わりに、アルミニウムや希士 類元素を用いても、表 1 に示すように、同様の結 果を得ることができる。

(以下余白)

8

また、本発明における添加物の添加量の好適範囲は金属酸化物を $(N_*V_{1-x})_*0_*$ で表現した場合、 $X=0.001\sim0.5$ である。0.001以下であると添加による抵抗変化率向上効果が現われず、0.5を超えても抵抗変化率が劣化する。

(発明の効果)

動法より低い温度で焼動しても良好な特性のものが得られるから、焼勧時におけるバナジウムの蒸発の問題が緩和され、目的とする組成の酸化物を容易に得ることができる。

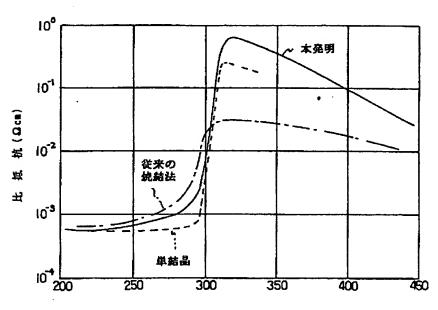
図面の簡単な説明

第1図は木苑明法、従来の焼鮎法により得られた金属像化物と、単結晶の金属酸化物の温度に対する抵抗変化を比較して示す図である。

特許出願人 ディーディーケイ株式会社 代理人 弁理士 岩田勝一

1 1

第120



温 度(K)